

1260**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ**

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie stanowisk w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego

Na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stanowiskami służbowymi w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, na których występują warunki szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, na których przysługuje prawo do urlopu dodatkowego, są stanowiska, z opisu których wynika konieczność wykonywania obowiązków służbowych:

1) w warunkach narażenia na:

a) działanie substancji i preparatów bardzo toksycznych, którym zgodnie z kryteriami klasyfikacji określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych przypisano co najmniej jeden z następujących zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: R26, R27, R28, R39 i odpowiednie zwroty łączone,

b) działanie substancji i preparatów toksycznych, którym zgodnie z kryteriami klasyfikacji określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych przypisano co najmniej jeden z następujących zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: R23, R24, R25, R39, R48 i odpowiednie zwroty łączone,

c) substancje i preparaty, którym zgodnie z kryteriami klasyfikacji określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych przypisano zwrot R33;

2) w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25 °C lub poniżej 10 °C;

3) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone;

4) w środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80 %, w wodzie lub błocie;

5) w zaciemnionych pomieszczeniach, w których natężenie oświetlenia ze względów technologicznych jest poniżej wartości określonych w Polskich Normach, w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych;

6) w pomieszczeniach pozbawionych stałego oświetlenia lub w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie sztuczne oświetlenie;

7) w radiowych obiektach nadawczych i centrach radiodiodobiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych;

8) w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym;

9) w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu — zgodnie z przepisami w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

10) w warunkach narażenia na hałas przekraczający dopuszczalne wartości określone w odrębnych przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

11) przy załadunku, rozładunku, transporcie i magazynowaniu paliw oraz uzupełnianiu nim sprzętu;

12) przy wytwarzaniu, niszczeniu oraz magazynowaniu i transportowaniu materiałów wybuchowych, łatwo palnych i samozapalnych;

13) pod ziemią lub wodą;

14) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące;

15) w warunkach narażenia na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich;

16) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia;

17) przy obsłudze, w formie pełnienia stałych dyżurów, źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 0,2 MHz do 300 000 MHz w warunkach zmieniającego się natężenia na granicy strefy zagrożenia i strefy pośredniej;

18) w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub substancji i preparatów zaklasyfikowanych zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach o substancjach i preparatach chemicznych jako mutagenne kategorii 1 i 2 lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 i 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: *R. Sikorski*